

株式会社 トリケミカル研究所

第41期(2019年1月期)

第2四半期決算説明資料

東京証券取引所
証券コード:4369

2018.9.6

1. 2019年1月期第2四半期決算実績

2019年1月期第2四半期連結業績の概要(総括)

単位:百万円

	19.1期 上期実績	19.1期 上期計画	計画比	(ご参考) 18.1期 上期(単体)	(ご参考)前年同期比	
					増減額	増減率
売上高	3,800	3,570	106.5%	2,955	845	28.6%
営業利益	1,042	890	117.1%	757	284	37.6%
経常利益	1,155	900	128.4%	766	388	50.7%
当期純利益	836	620	135.0%	533	303	56.9%

！半期としては創業来最高の売上高・利益を達成

！韓国関係会社SK Tri Chem等による持分法利益122百万円計上

！今期より連結財務諸表を作成

※18.1期実績は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

連結貸借対照表

単位:百万円

	(連結) 18/7月末		(ご参考:単体) 18.1期末
流動資産	5,043	流動資産	4,486
固定資産	4,898	固定資産	4,545
資産合計	9,941	資産合計	9,032
流動負債	2,602	流動負債	2,774
固定負債	1,703	固定負債	1,168
負債合計	4,306	負債合計	3,943
株主資本	5,638	株主資本	5,085
その他包括利益累計額	-3	評価・換算差額等	3
純資産合計	5,634	純資産合計	5,089
負債純資産合計	9,941	負債純資産合計	9,032

※19.1期より連結決算に移行しているため、増減は記載しておりません。

連結キャッシュ・フロー

単位:百万円

	19.1期上期
営業活動による キャッシュ・フロー	554
投資活動による キャッシュ・フロー	-987
財務活動による キャッシュ・フロー	536
現金及び現金 同等物の増減額	101
現金及び現金同等 物の四半期末残高	1,273

各CFの状況等

営業CF

税前純利益計上	1,155
減価償却費計上	233
売上債権の増加	-329
法人税等の支払額	-330
たな卸資産の増加	-132

投資CF

有形固定資産の取得 **-972**

財務CF

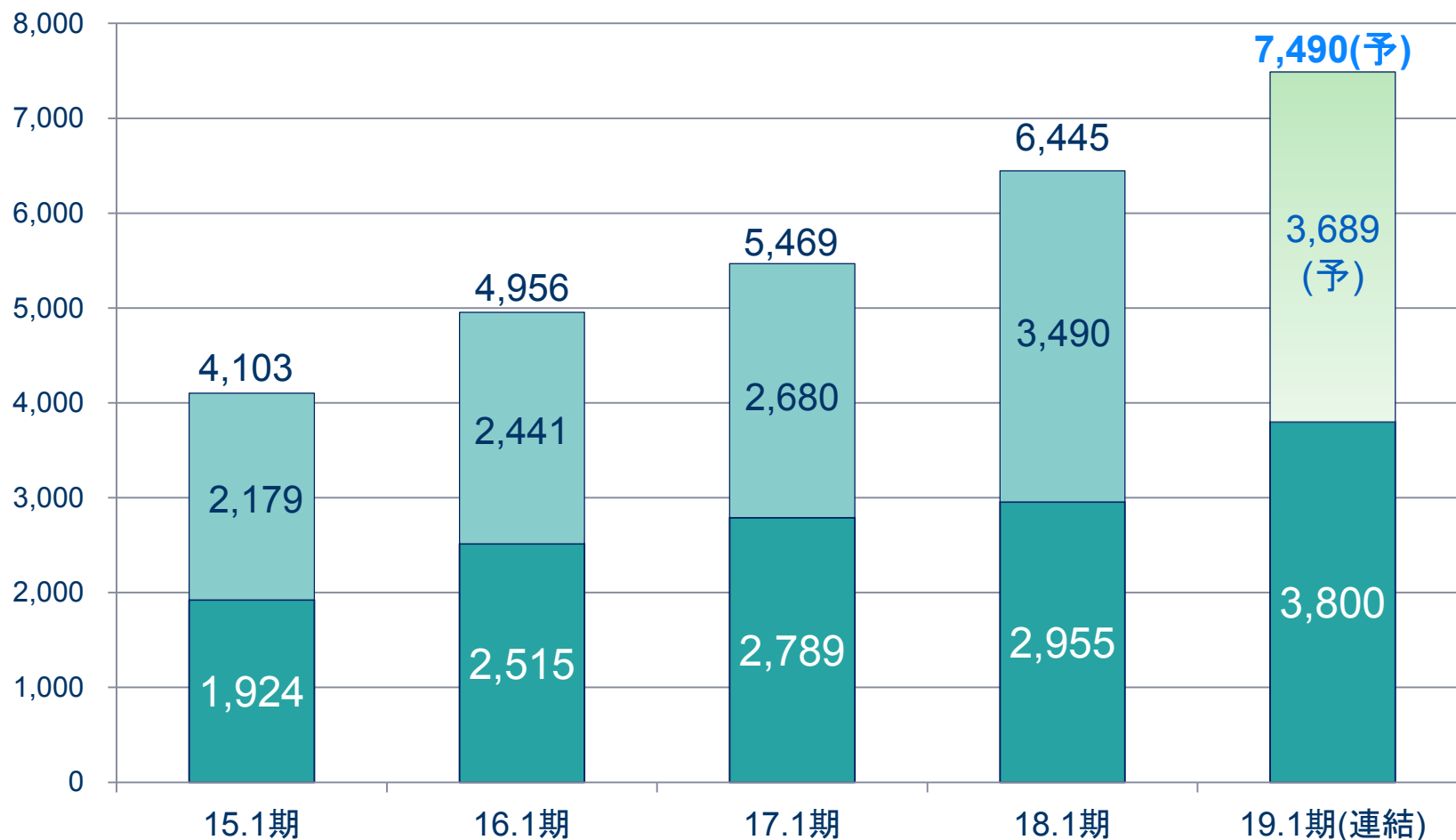
長期借入金調達・返済 701
配当金の支払 **-163**

※19.1期より連結決算に移行しているため、比較はしていません。

販売実績

単位：百万円

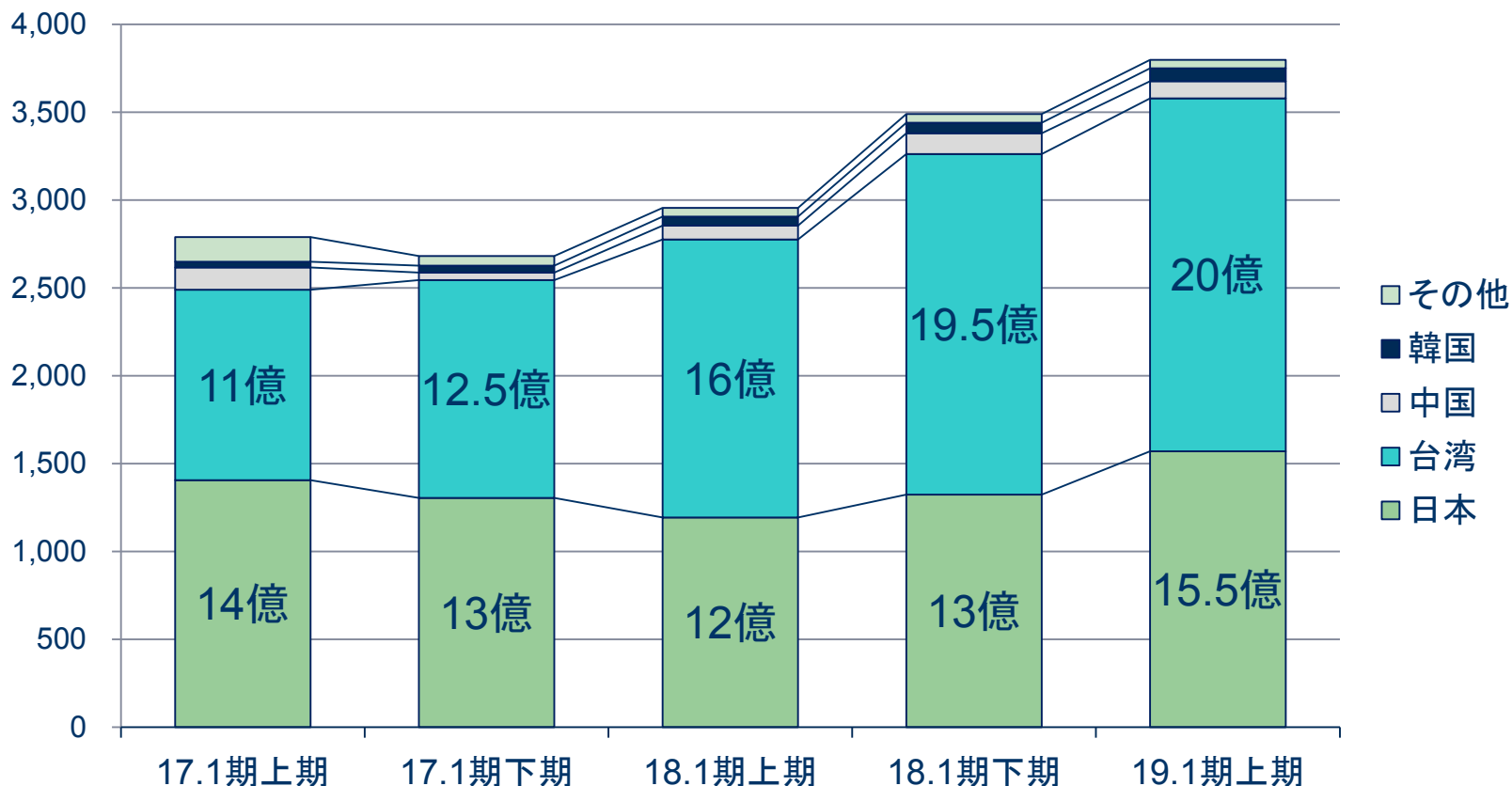
(下部は上期実績)



※18.1期までは単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

売上分析(ユーザー地域別)

単位: 百万円



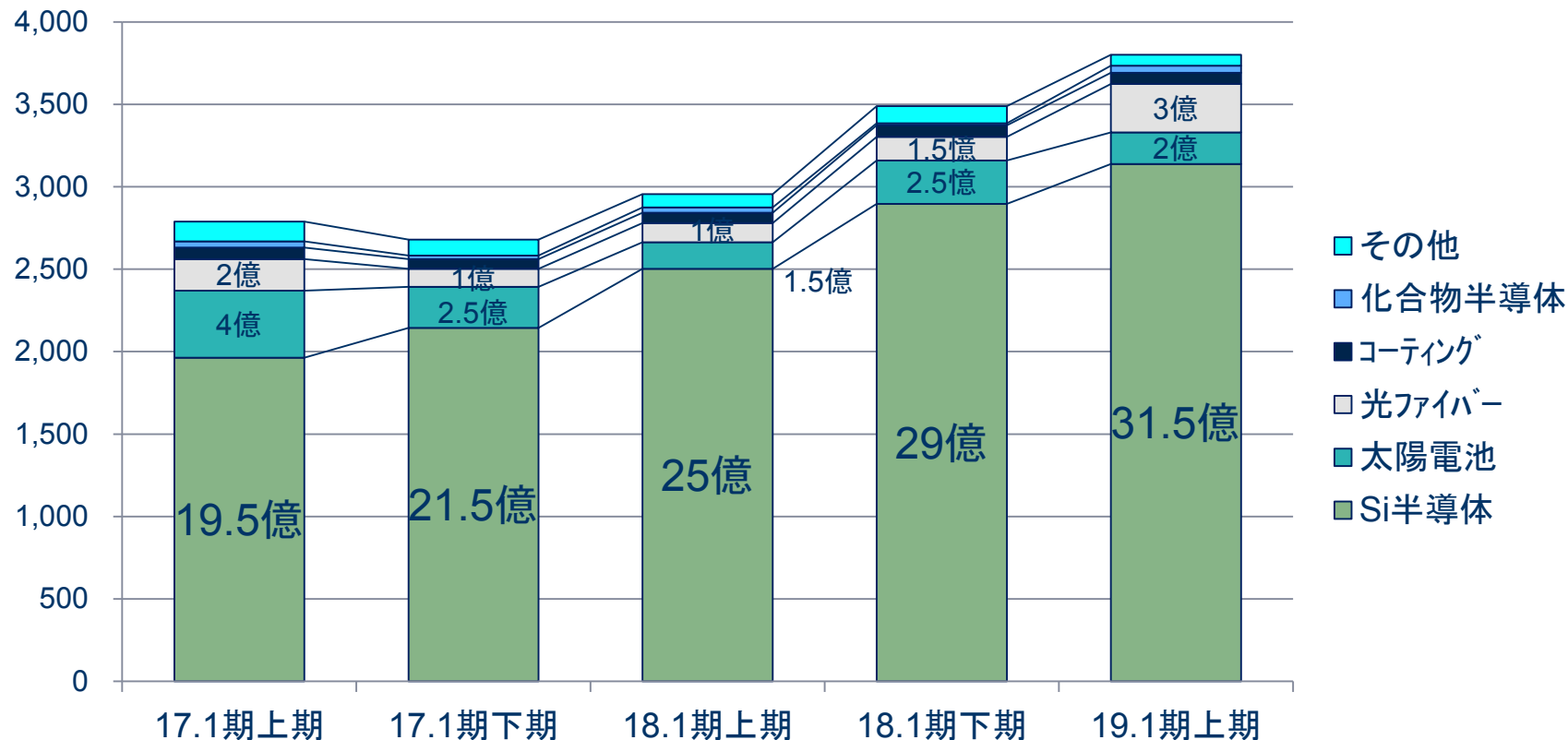
※当社推定による概算値

！台湾、国内向け売上とも前年を上回る

※18.1期までは単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

売上分析(製品用途別)

単位: 百万円



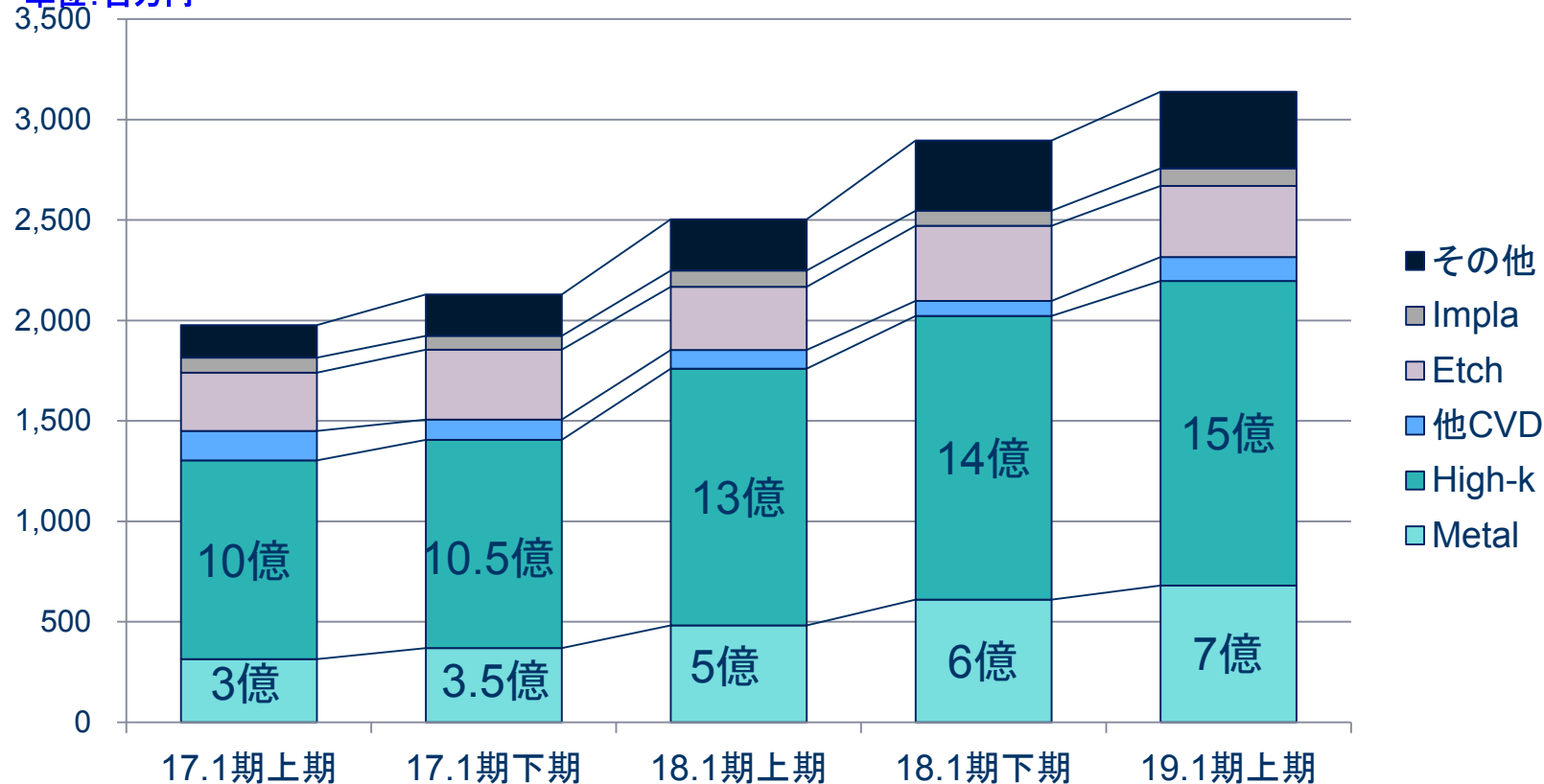
※当社推定による概算値

！半導体を中心に全体的に順調な推移

※18.1期までは単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

売上分析(Si半導体)

単位: 百万円



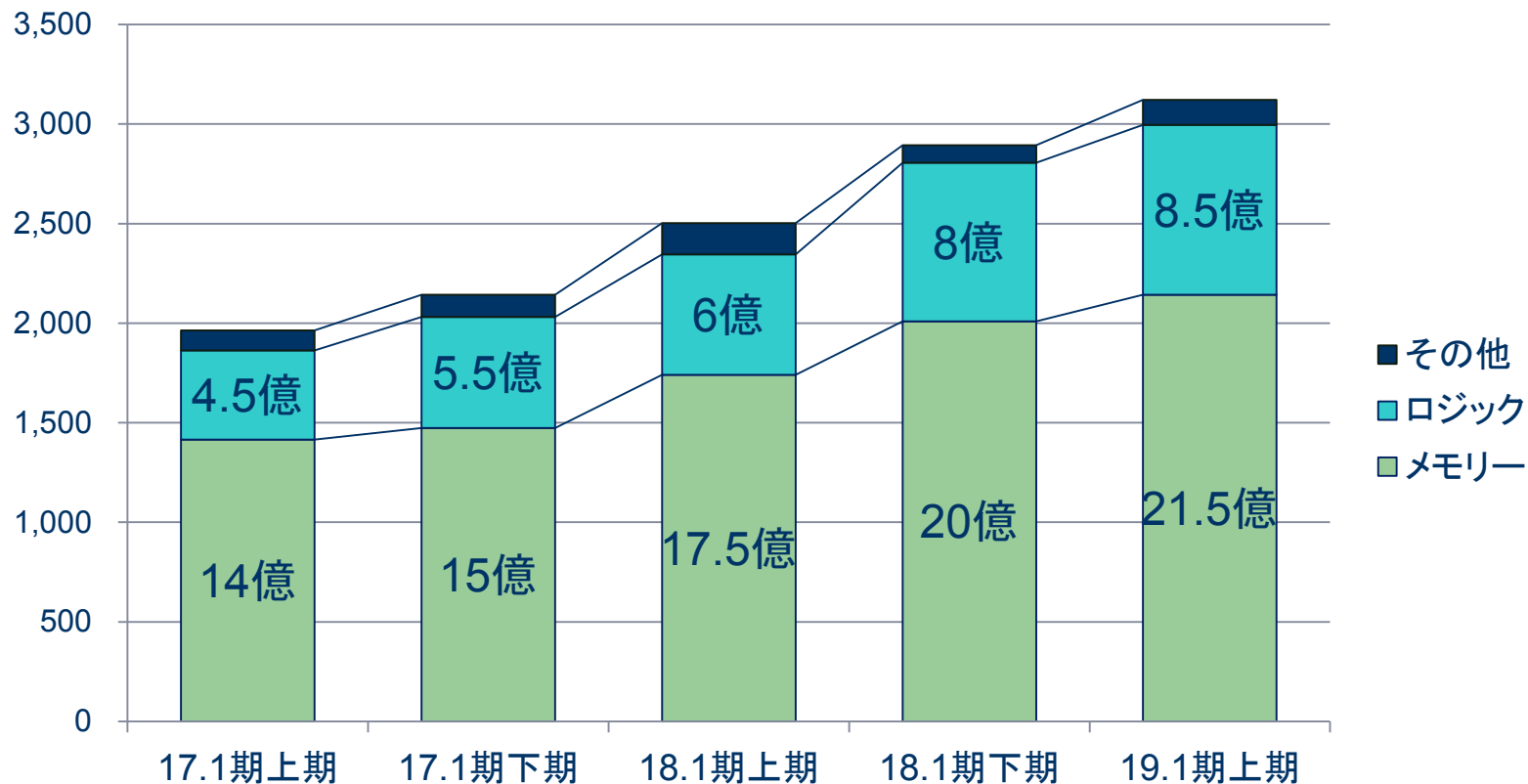
※当社推定による概算値

! High-k向け、Metal向け材料は成長を維持

※18.1期までは単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

売上分析(半導体向け先別)

単位:百万円



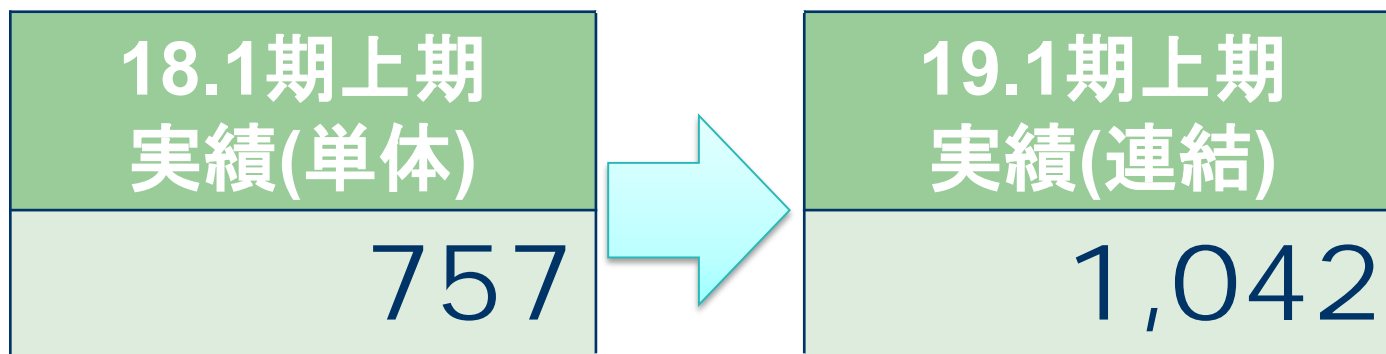
※当社推定による概算値

！ロジック向け売上が大幅増

※18.1期までは単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

2019年1月期営業利益増減要因

(ご参考)営業利益比較



単位:百万円

**！ 業容の拡大により労務費・経費等は増加するも
それら費用増を上回る売上高の成長により
利益面でも額・収益性ともに成長**

※19.1期より連結決算に移行しているため、個々の要因による増減分析はしていません。

2. 2019年1月期通期見通し及び戦略

2019年1月期通期見通し

単位: 百万円

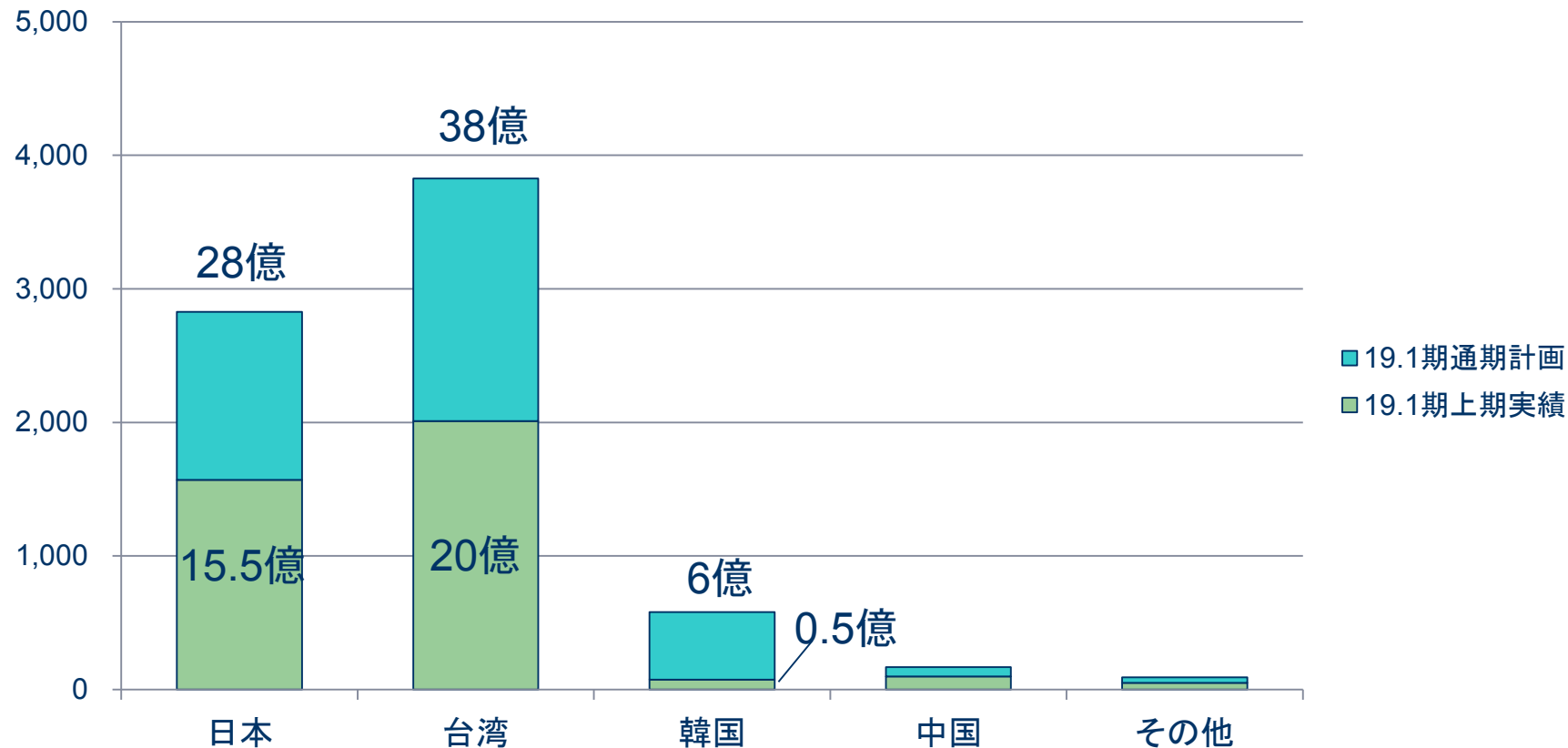
	19.1期上期	19.1期通期 (計画)	進捗率	(ご参考) 18.1期通期
売上高	3,800	7,490	50.7%	6,445
営業利益	1,042	1,910	54.6%	1,598
経常利益	1,155	1,940	59.6%	1,622
当期純利益	836	1,330	62.9%	1,145

！ 上期は概ね堅調に進捗

※18.1期実績は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

売上進捗分析(ユーザー地域別)

単位:百万円

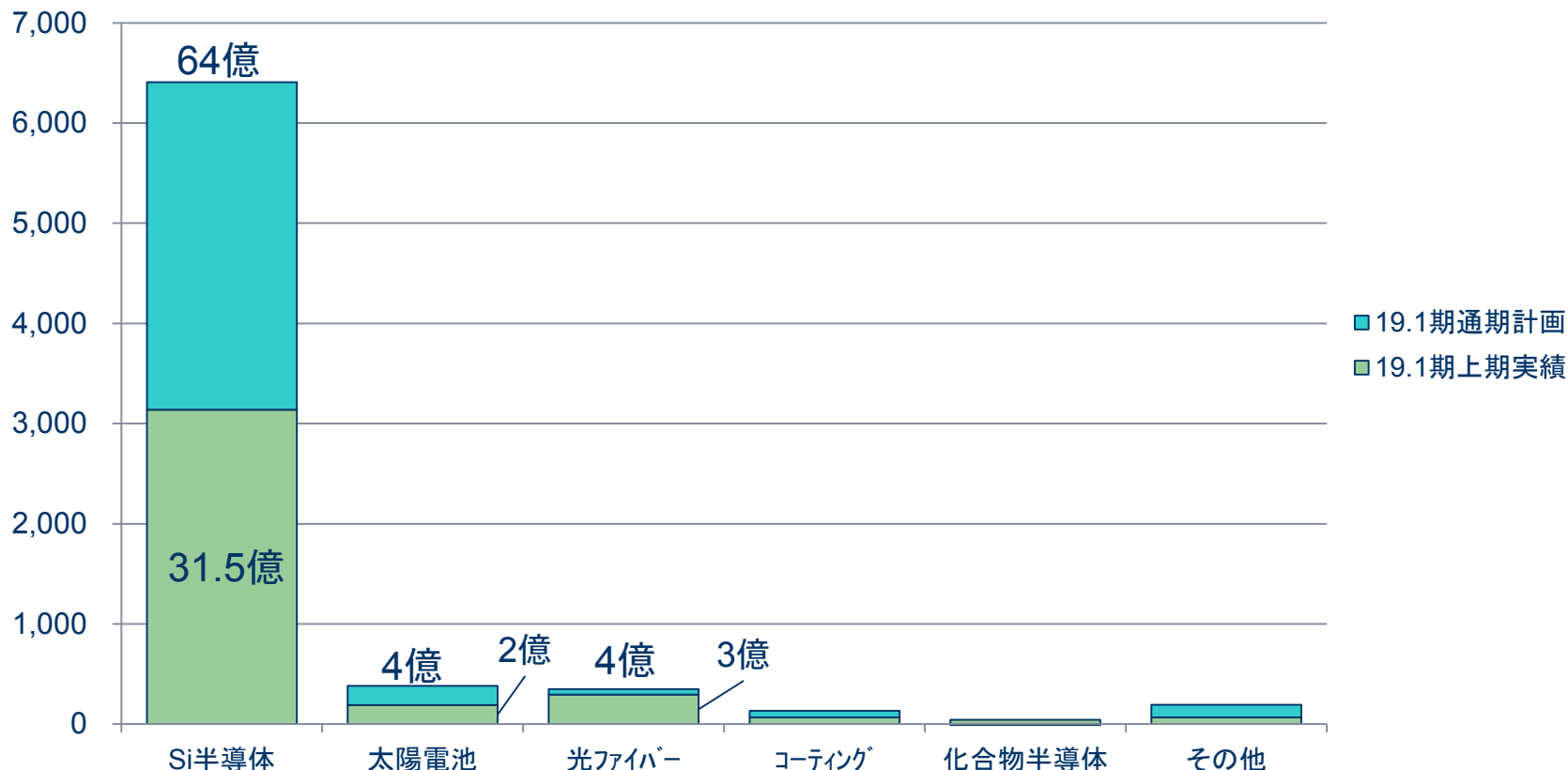


※当社推定による概算値

！韓国JV向け新規材料の売上成長が下期の大きな目標

売上進捗分析(製品用途別)

単位: 百万円

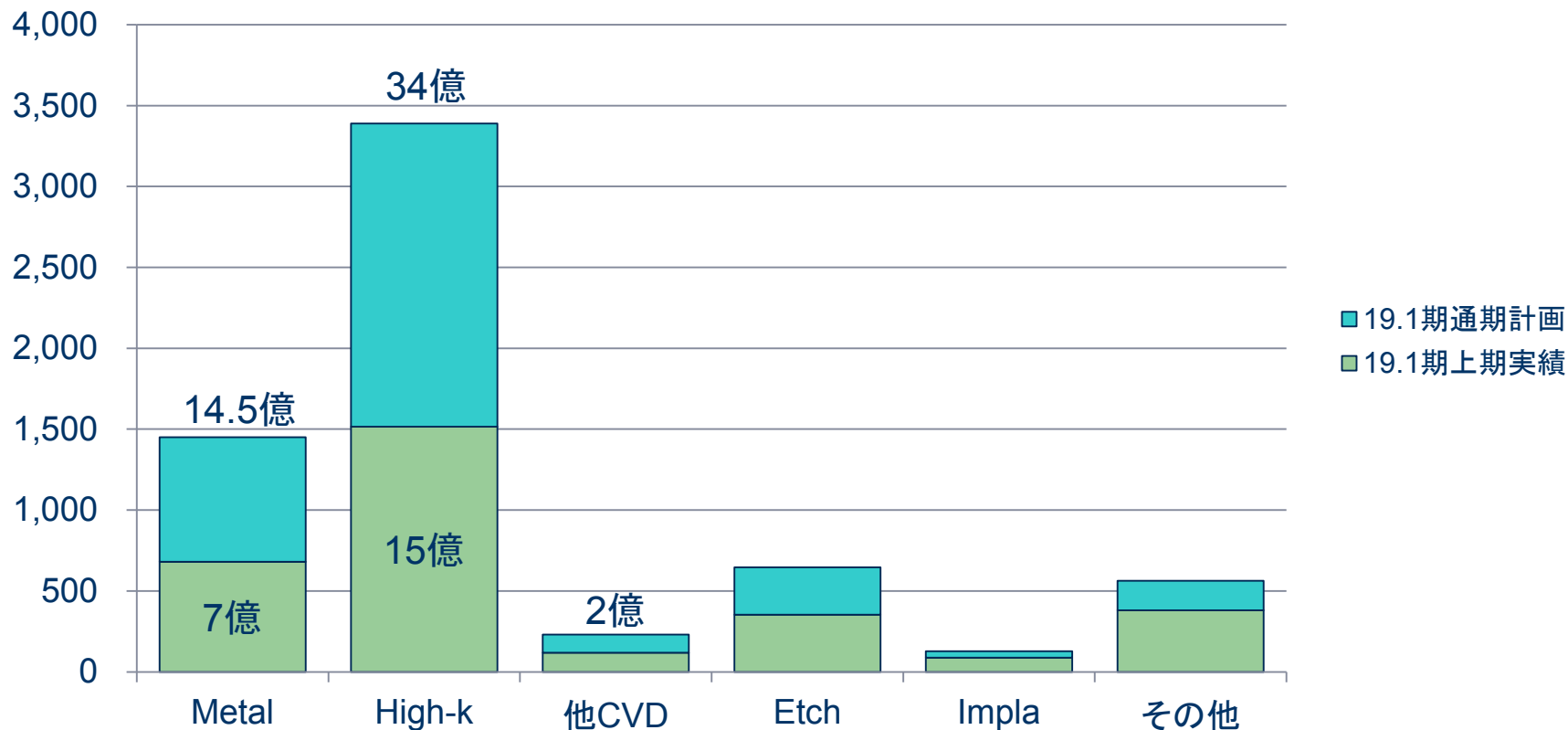


※当社推定による概算値

！半導体向け材料売上は下期さらに増加見込み

売上進捗分析(Si半導体)

単位: 百万円

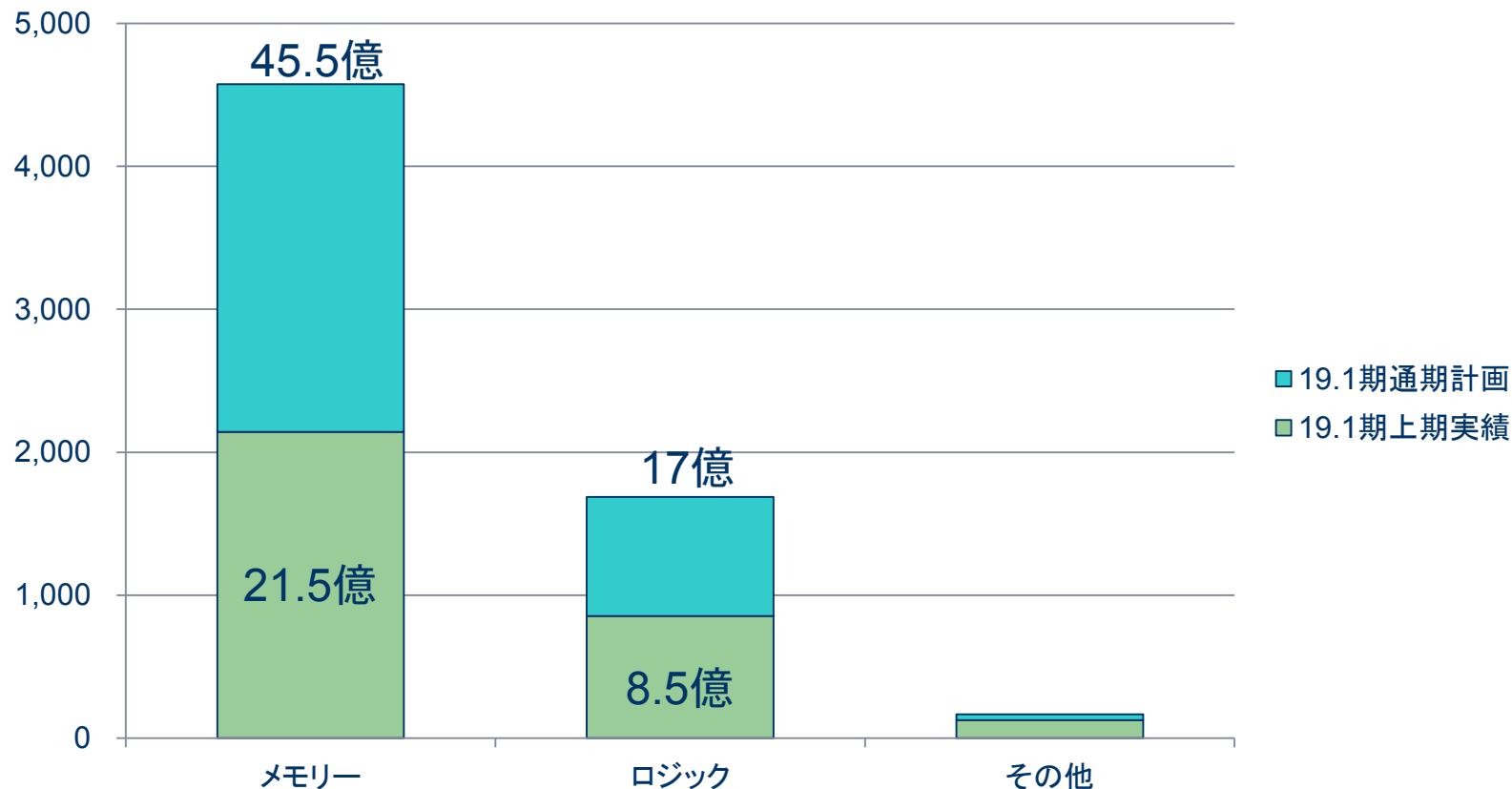


※当社推定による概算値

！主力のHigh-k、Metal向け材料は更なる成長を目論む

売上進捗分析(半導体向け先別)

単位: 百万円



※当社推定による概算値

！下期はメモリー向け材料の成長をもくろむ

2019年1月期下期の見通し

外部環境見通しなど

1. 半導体工場は堅調な稼働を持続
2. 太陽電池市場は回復基調も低位安定
3. 光ファイバー市場は堅調に推移
4. 想定レートは\$1=¥107(期初から変更なし)
感応度は1円で約15百万円

下期の施策

1. 韓国JVの本格稼働のための協力体制強化
2. 新規材料(Metal、High-k材料等)の生産性向上

3. 中期経営計画各施策の進捗について

1.上野原第二工場増築



！ 建物はほぼ予定通り竣工済み
！ 現在順次装置搬入及び立ち上げ作業中

2.三化電子材料股份有限公司(台湾子会社)

今秋着工に向け
建築会社を選定中
2019年中の竣工を目指す

工場完成予想図



3.SK Tri Chem Co., Ltd.(韓国関連会社)



- ・徐々に事業を拡大、取扱製品数も増加
- ・下期より当社からの原材料供給も拡大見込み

4.計画策定時の外部環境予測→ほぼ想定通りの推移、変更なし

➤IoT・AIによる用途の拡大、HDD→SSDへの置き換えニーズ

➤半導体微細化により材料、プロセスは進化
(新材料ニーズ・3D積層等)

➤太陽電池市場は安定、光ファイバー市場は堅調 ※想定より改善

この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいております。
あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先 : homepageinfo2@trichemical.com

用語集(Page 9・16)

Impla

Ion Implantation=イオン注入。半導体に使用されるSi(シリコン)は本来電気を通しにくい物質ですが、ホウ素やリン等のイオンを注入することで、条件によって絶縁性能が変化する「半導体」となります。

Etch

Etching(エッチング)。ウエハ上に積んだ膜のうち、不要なものを化学反応により削る工程です。

CVD材料

CVD(Chemical Vapor Deposition:化学気相成長)法とは、化学材料の蒸気を熱などにより分解しウエハ上に堆積させる技術であり、**CVD材料**とはその際に用いられる化学材料を指します。堆積させる薄い膜は絶縁膜や金属・導体膜・半導体膜であり、使用される材料は多岐にわたっております。

また、半導体の微細化・高性能化を進めるために、従来の製法・材料では解決できない電気的な問題を解決するための誘電率の低い膜が得られる低誘電率層間絶縁膜(Low-k)材料や逆に誘電率の高い膜が得られる高誘電率絶縁膜(**High-k**)材料・物理的な問題を解決するための金属窒化膜(**Metal**)材料などといった新たなニーズに対応するための材料をいち早く提案し、安定供給するのが当社の特徴であります。